

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月1日(01.05.2025)



(10) 国際公開番号

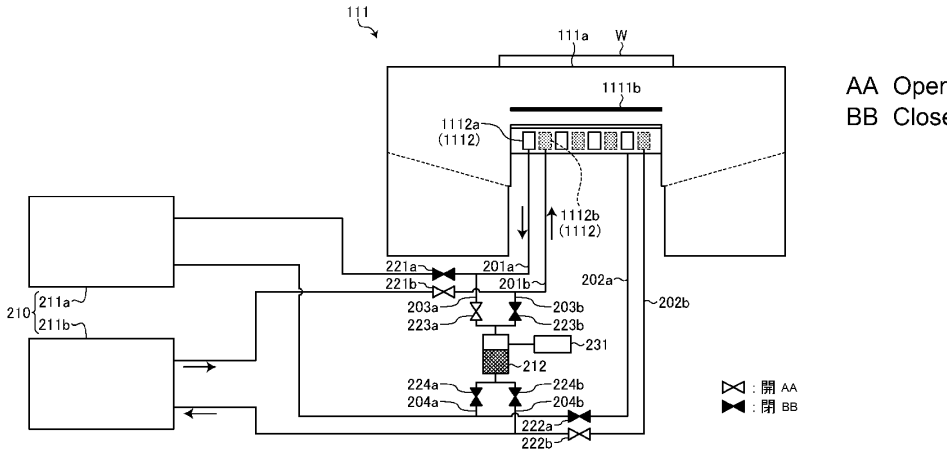
WO 2025/089107 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) G05D 23/13 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/036382
- (22) 国際出願日: 2024年10月11日(11.10.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-183353 2023年10月25日(25.10.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).
- (72) 発明者: 原 島 卓 也 (HARASHIMA, Takuya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所 (SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎ノ門ダイビルイースト (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, TEMPERATURE CONTROL APPARATUS, AND TEMPERATURE CONTROL METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置、温度制御装置及び温度制御方法

【図3C】



(57) Abstract: A plasma processing system according to the present invention comprises a supply unit 210, a body unit 111, and a control unit 2. The supply unit 210 is configured to be able to supply a plurality of heat media each having a different temperature. In the body unit 111, a plurality of flow paths 1112 capable of allowing for flows of a plurality of heat mediums are each separately formed, constituting the plasma processing system. The control unit 2 is configured to perform control such that, when a first heat medium among the plurality of heat media is caused to flow from the supply unit 210 to a flow path 1112, the heat medium other than the first heat medium among the plurality of heat media is

〔続葉有〕

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

discharged from the flow path 1112.

(57) 要約: プラズマ処理システムは、供給部210と、本体部111と、制御部2とを有する。供給部210は、それぞれ異なる温度とされた複数の熱媒体をそれぞれ供給可能に構成される。本体部111は、複数の熱媒体をそれぞれ個別に流すことが可能な複数の流路1112が形成され、プラズマ処理システムを構成する。制御部2は、供給部210から複数の熱媒体のうちの第1熱媒体を流路1112に流す場合、複数の熱媒体のうちの第1熱媒体以外の熱媒体を流路1112から排出するように制御するように構成される。